

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2002 年 1 月 24 日 (24.01.2002)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 02/07200 A1

(51) 国際特許分類: H01L 21/306, C23F 1/16

(21) 国際出願番号: PCT/JP01/06048

(22) 国際出願日: 2001 年 7 月 12 日 (12.07.2001)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:

特願2000-214206 2000 年 7 月 14 日 (14.07.2000) JP

特願2000-214232 2000 年 7 月 14 日 (14.07.2000) JP

(72) 発明者: 南場 哲 (NANBA, Satoshi). 丸山 岳人 (MARUYAMA, Taketo). 阿部久起 (ABE, Hisaki). 青山 哲男 (AOYAMA, Tetsuo); 〒950-3112 新潟県新潟市太夫浜新割182 三菱瓦斯化学株式会社 新潟研究所内 Niigata (JP).

(74) 代理人: 大谷 保 (OHTANI, Tamotsu); 〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目8番27号 巴町アネックス2号館 4階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): KR, SG.

添付公開書類:
— 国際調査報告書

(71) 出願人: 三菱瓦斯化学株式会社 (MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.) [JP/JP]; 〒100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 Tokyo (JP).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: ETCHING COMPOSITIONS

(54) 発明の名称: エッチング用組成物

(57) Abstract: An etching composition which comprises an aqueous solution containing oxalic acid and an aromatic hydrocarbon compound having a phenolic hydroxyl group; and an etching composition characterized by being an aqueous solution containing oxalic acid and a nitrogenous carboxylic acid and/or salt thereof. With the etchants, etching can be conducted under mild conditions without generating any etching residue.

(57) 要約:

シュウ酸とフェノール性水酸基を有する芳香族炭化水素化合物とを含有する水溶液からなるエッチング用組成物、並びにシュウ酸と窒素含有カルボン酸および／または窒素含有カルボン酸の塩とを含有する水溶液であることを特徴とするエッチング用組成物である。エッチング残渣を全く発生せず、且つ、温和な条件下で、エッチングが行えるエッチング剤を提供する。



WO 02/07200 A1